zał. 10.8a Tabela T1 2018_05 - obejmująca część ideową i realizacyjną inwestycji

ETAP I R	id_kom	8nazwa_stanowiska	10masa	11dług	12szer	13wys	14nrpom	15powierzc	16todn	17a-kat_ttol	19powietrz	20wilg	21wilgtol	22czystpow	23a-kat_drgań	24hałas	25V	26kW	27uziem	28a-kat_ekran	29zakem	35inswod	36instpow	37inninst	38l_nauk	40uwagi
PRAWDA	L1_1	Komora bezechowa duża z pomieszczeniem kontrolnym i wyposażeniem pomiarowym	400000	11	9	12	5	12	23	T0	0,35	50	15	1000000	V0		230		w		1000000	NIE	FAŁSZ	Podwójne ściany, pomieszczenie wewnętrzne wyłożone klinami pochłaniającymi, posadowione na izolacji antywibracyjnej	0,25	3) pod wrunkiem braku źródeł promieniowania e-m w pobliżu' 4) komora posadowiona na wibroizolatorach 5) istotny jest jak najmniejszy hałas wewnątrz komory, możliwie bliski 0 dB
PRAWDA	L1_2	Komora bezechowa mała z pomieszczeniem kontrolnym i wyposażeniem pomiarowym	300000	8	7	7	6	12	23	T0	0,35	50	15	1000000	V0	1000000	230		w		1000000	NIE	FAŁSZ	Podwójne ściany, pomieszczenie wewnętrzne wyłożone klinami pochłaniającymi, posadowione na izolacji antywibracyjnej	0,25	3) pod wrunkiem braku źródeł promieniowania e-m w pobliżu' 4) komora posadowiona na wibroizolatorach 5) istotny jest jak najmniejszy hałas wewnątrz komory, możliwie bliski 0 dB
FAŁSZ	L1_3	Komora bezechowa z podłogą odbijającą z pomieszczeniem kontrolnym i wyposażeniem pomiarowym	300000	8	7	8	7	12	23	T0	0,35	50	15	1000000	V0	1000000	230		w		1000000	NIE	FAŁSZ	Podwójne ściany, pomieszczenie wewnętrzne wyłożone klinami pochłaniającymi (podłoga odbijająca), posadowione na izolacji antywibracyjnej	0,25	3) pod wrunkiem braku źródeł promieniowania e-m w pobliżu' 4) komora posadowiona na wibroizolatorach 5) istotny jest jak najmniejszy hałas wewnątrz komory < 10 dB
FAŁSZ	L1_4	Komora pogłosowa z pomieszczeniem kontrolnym i wyposażeniem pomiarowym	300000	8	7	6	8	12	23	T0	0,35	50	15	1000000	V0	1000000	230		w		1000000	NIE	FAŁSZ	pomieszczenie o wszystkich powierzchniach nierównoległych	0,25	3) pod wrunkiem braku źródeł promieniowania e-m w pobliżu' 6) pomiesz-czenie odseparowane od pozostałej części budynku '7) istotny jest hałas wewnątrz komory, poziom tła akustycznego nie powinein przekraczać 20 dB
FAŁSZ	L1_5	Stanowisko do badań przetworników sejsmicznych i geofonów (w zakresie bardzo niskich częstotliwości)	4200	5	3,5	3	11	0	23	T0	35	50	15	1000000	V1	1000000	230	2	w		1000000	TAK	PRAWDA	1) sieć informatyczna wysokiej jakości 2) klimatyzacja zapewniająca laminarny przepływ powietrza	0,3	1) podłogi antystatyczne odporne na działania mechaniczne 2) hałas w pomieszczeniu < 35 dB
FAŁSZ	L1_6	Stanowisko do badań przetworników drgań i przyrządów skonstruowanych w oparciu o nowe technologie i/lub wymagających badań wieloparametrowych oraz do badań właściwości wibroizolacyjnych materiałów	500	5	3,5	3	14	0	23	T0	35	50	15	1000000		1000000	230	2	w		1000000	NIE	FAŁSZ	1) sieć informatyczna wysokiej jakości 2) klimatyzacja zapewniająca laminarny przepływ powietrza	0,2	1) podłogi antystatyczne odporne na działania mechaniczne 2) hałas w pomieszczeniu < 35 dB
FAŁSZ	L1_7	Stanowisko do badań w dziedzinie ultradźwięków dla zastosowań przemysłowych	300	5	4	3	10	0	23	T0	1000000			1000000		1000000	230		w		1000000	TAK	FAŁSZ	- stół z aktywną wibroizolacją (sprężarka na wyposażeniu)	0,5	1) stół pomiarowy z aktywną wibroizolacją 2) istotny jest hałas wewnątrz pomieszczenia: < 35 dB 3) pod wrunkiem braku źródeł promieniowania e-m w pobliżu 7) poziom -1, o ile zapewni dobrą separację od drgań podłoża
FAŁSZ	L1_8	Stanowisko do badań wzorców akustycznych w zakresie bardzo dużych wartości ciśnienia akustycznego.	500	3	2	3	2	0	23	T0	0,35	50	15	1000000		1000000	230		w		1000000	NIE	FAŁSZ		0,25	
FAŁSZ	L1_9	Stanowisko do odtwarzania jednostki oraz badań w zakresie drgań skrętnych	500	5	3,5	3	13	0	23	T0	35	50	15	1000000	V1	1000000	230	2	w		1000000	TAK	PRAWDA	1) sieć informatyczna wysokiej jakości 2) klimatyzacja zapewniająca laminarny przepływ powietrza	0,2	1) podłogi antystatyczne odporne na działania mechaniczne 2) hałas w pomieszczeniu < 35 dB
FAŁSZ	L1_10	Stanowisko wzorca pierwotnego udarów	200	5	3,5	3	15	0	23	T0	35	50	15	1000000		1000000	230	2	w		1000000	TAK	PRAWDA	1) sieć informatyczna wysokiej jakości 2) klimatyzacja zapewniająca laminarny przepływ powietrza	0,3	1) podłogi antystatyczne odporne na działania mechaniczne 2) hałas w pomieszczeniu < 35 dB
FAŁSZ	L1_11	Stanowisko wzorca pierwotnego: wzorcowanie hydrofonów metodą pierwotną	500	3	4	3	9	0	23	T0	1000000			1000000	V1	1000000	230		w		1000000	TAK	FAŁSZ	- stół z aktywną wibroizolacją (sprężarka na wyposażeniu)	0,5	1) stół pomiarowy z aktywną wibroizolacją 2) istotny jest hałas wewnątrz pomieszczenia: < 35 dB 3) pod wrunkiem braku źródeł promieniowania e-m w pobliżu 7) poziom -1, o ile zapewni dobrą separację od drgań podłoża
FAŁSZ	L1_12	Stanowiska do badań różnego rodzaju aparatury do pomiaru drgań mechanicznych (badania mechaniczne i elektryczne)	500	4	3,5	3	12	0	23	T0	35	50	15	1000000		1000000	230	1	w		1000000	NIE	FAŁSZ	1) sieć informatyczna wysokiej jakości 2) klimatyzacja zapewniająca laminarny przepływ powietrza	1	1) podłogi antystatyczne odporne na działania mechaniczne 2) hałas w pomieszczeniu < 35 dB
FAŁSZ	L1_13	Stanowiska do badań wtórnych wzorców drgań (przekazywanie jednostek wielkości drgań mechanicznych) w zakresie średnich częstotliwości	500	4	3,5	3	12	0	23	T0	35	50	15	1000000		1000000	230	1,5	w		1000000	NIE	FAŁSZ	1) sieć informatyczna wysokiej jakości 2) klimatyzacja zapewniająca laminarny przepływ powietrza	1	1) podstawy wibroizolacyjne pod wzbudniki 2) podłogi antystatyczne odporne na działania mechaniczne 3) hałas w pomieszczeniu < 35 dB
FAŁSZ	L1_14	Stanowiska do badań wzorców akustycznych wtórnych (przekazywanie jednostki ciśnienia akustycznego w zakresie częstotliwości słyszalnych, infradźwięków i ultradźwięków)	500	5	4	3	2	0	23	T0	0,35	50	15	1000000		1000000	230		w		1000000	NIE	FAŁSZ	- stoły pomiarowe z aktywną wibroizolacją (sprężarka na wyposażeniu) - klimaty-zacja zapewniająca laminarny przepływ powietrza	1,5	1) stół pomiarowy z aktywna wibroizolacją 2) istotny jest hałas wewnątrz pomieszczenia: < 35 dB 3) pod wrunkiem braku źródeł promieniowania e-m w pobliżu
FAŁSZ	L1_15	Stanowiska do badań wzorców audiometrycznych i aparatury audiometrycznej	300	5	4	3	3	0	23	T0	0,35	50	15	1000000		1000000	230		w		1000000	NIE	FAŁSZ	- stół z aktywną wibroizolacją (sprężarka na wyposażeniu) - klimaty-zacja zapewniająca laminarny przepływ powietrza	1	1) stół pomiarowy z aktywna wibroizolacją 2) istotny jest hałas wewnątrz pomieszczenia: < 35 dB 3) pod wrunkiem braku źródeł promieniowania e-m w pobliżu
FAŁSZ	L1_16	Stanowisko do badania typu mierników poziomu dźwięku i innych badań dotyczących aparatury akustycznej i właściwości materiałów	200	5	4	3	4	0	23	T0	0,35	50	15	1000000		1000000	230		w		1000000	NIE	FAŁSZ		1	2) istotny jest hałas wewnątrz pomieszczenia: < 35 dB 3) pod wrunkiem braku źródeł promieniowania e-m w pobliżu
FAŁSZ	L1_17	Stanowisko do odtwarzania jednostki oraz badań w zakresie udarów	500	5	3,5	3	11	0	23	T0	35	50	15	1000000		1000000	230	2	w		1000000	TAK	PRAWDA	1) sieć informatyczna wysokiej jakości 2) klimatyzacja zapewniająca laminarny przepływ powietrza	0,25	1) podłogi antystatyczne odporne na działania mechaniczne 2) pomieszczenie pomocnicze 12 m2 wykazane wcześniej (pom. 1) 3) hałas w pomieszczeniu < 35 dB
FAŁSZ	L1_18	Stanowisko wzorca państwowego ciśnienia akustycznego (odtwarzanie jednostki ciśnienia akustycznego w warunkach ciśnieniowych metodą pierwotną)	300	5	4	3	1	0	23	T0	0,35	50	15	1000000		1000000	230		w		1000000	NIE	FAŁSZ	- stół z aktywną wibroizolacją (sprężarka na wyposażeniu) - klimaty-zacja zapewniająca laminarny przepływ powietrza	1	1) stół pomiarowy z aktywna wibroizolacją 2) istotny jest hałas wewnątrz pomieszczenia: < 35 dB 3) pod wrunkiem braku źródeł promieniowania e-m w pobliżu
FAŁSZ	L1_19	Stanowisko wzorca państwowego jednostek wielkości drgań mechanicznych (odtwarzanie jednostek wielkości drgań mechanicznych metodą pierwotną) i Stanowisko do badań wtórnych wzorców drgań (przekazywanie jednostek wielkości drgań mechanicznych) w zakresie n	4500	5	4	3	11	0	23	T0	35	50	15	1000000	V1	1000000	230	2	w		1000000	TAK	PRAWDA	1) sieć informatyczna wysokiej jakości 2) klimatyzacja zapewniająca laminarny przepływ powietrza	1,75	1) podstawa wibroizolacyjna (granit, beton) z dylatacją, zagłębiona w gruncie na ok. 0,8 m, więc poziom -3 2) podłogi antystatyczne odporne na działania mechaniczne 3) UPS (stanowisko włączone do sieci 24 h) 4) zminimalizowane promieniowanie cieplne ze
FAŁSZ	L1_20	Stanowiska do badania wagi mocy promieniowania metodą pierwotną i metodą porównawczą	300	3	2	3	9	6	23	T0	1000000			1000000	V1	1000000	230		w		1000000	TAK	FAŁSZ	- stół z aktywną wibroizolacją (sprężarka na wyposażeniu)	0,5	1) stół pomiarowy z aktywną wibroizolacją 2) istotny jest hałas wewnątrz pomieszczenia: < 35 dB 3) pod wrunkiem braku źródeł promieniowania e-m w pobliżu 7) poziom -1, o ile zapewni dobrą separację od drgań podłoża
FAŁSZ	L1_22	Stanowisko do badania ultradźwiękowej aparatury medycznej i innych badań w dziedzinie ultradźwięków dla zastosowań medycznych	100	3	2	3	9	0	23	T0	1000000			1000000	V1	1000000	230		w		1000000	TAK	FAŁSZ	- stół z aktywną wibroizolacją (sprężarka na wyposażeniu)	0,5	1) stół pomiarowy z aktywną wibroizolacją 2) istotny jest hałas wewnątrz pomieszczenia: < 35 dB 3) pod wrunkiem braku źródeł promieniowania e-m w pobliżu 7) poziom -1, o ile zapewni dobrą separację od drgań podłoża
FAŁSZ	L1_23	Stanowisko do badań hydrofonów i innych przetworników metodą porównawczą	500	3	2	3	9	0	23	T0	1000000			1000000	V1	1000000	230		w		1000000	TAK	FAŁSZ	- stół z aktywną wibroizolacją (sprężarka na wyposażeniu)	0,5	1) stół pomiarowy z aktywną wibroizolacją 2) istotny jest hałas wewnątrz pomieszczenia: < 35 dB 3) pod wrunkiem braku źródeł promieniowania e-m w pobliżu 7) poziom -1, o ile zapewni dobrą separację od drgań podłoża
PRAWDA	L2_1	stanowisko pomiarowo-badawcze budowy i rozwoju pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości (w tym również grzebień częstości,wnęka optyczna, systemy do satelitarnego transferu czasu i częstotliwości oraz do światłowodowej dystrybucji częstotliwości op	4000	20	4	3	12	15	20	T2	15	50	5	ISO 6	V2	45	230	15	w	EM0		TAK	FAŁSZ	światłowodowa i kable koncentryczne do transmisji wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości	4	KRYTYCZNE DLA TEGO STANOWISKA JEST STAŁY DOSTĘP DO ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO (CIEMNE WŁÓKNA) DO SIEDZIBY GUM W WARSZAWIE - transmisja wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości oraz docelowo nośnej optycznej (koszt komercyjny utrzymywajnia tego rodzaju łącz j
PRAWDA	L2_2	stanowisko pomiarowo-badawcze budowy i rozwoju pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości (w tym również grzebień częstości,wnęka optyczna, systemy do satelitarnego transferu czasu i częstotliwości oraz do światłowodowej dystrybucji częstotliwości op	2000	6	5	3	3	0	20	T0	1000000	50	5	1000000		1000000	230	5	w	EM0		NIE	FAŁSZ	światłowodowa i kable koncentryczne do transmisji wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości	0	niezbędne jest zapewnienie ciągłości zasilania 230 V AC oraz rezerwowego zasilania stałopradowego 24 V DC (np. akumulornia + spalinowy agregat prądotwórczy), drzwi do pomieszczenia powinny być przeszklone, najlepiej w bezpośredniej bliskości pomieszczenia
PRAWDA	L2_3	stanowisko pomiarowo-badawcze budowy i rozwoju pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości (w tym również grzebień częstości,wnęka optyczna, systemy do satelitarnego transferu czasu i częstotliwości oraz do światłowodowej dystrybucji częstotliwości op	1000	5	4	3	4	0	20	T0	1000000	50	5	1000000		1000000	230	5	w	EM0		NIE	FAŁSZ	światłowodowa i kable koncentryczne do transmisji wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości	0	niezbędne jest zapewnienie ciągłości zasilania 230 V AC oraz rezerwowego zasilania stałopradowego 24 V DC (np. akumulornia + spalinowy agregat prądotwórczy), najlepiej w bezpośredniej bliskości pomieszczenia zegarów atomowych - konieczność poprowadzenia m

PRAWDA	L2_4	stanowisko pomiarowo-badawcze budowy i rozwoju pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości (w tym również grzebień częstości,wnęka optyczna, systemy do satelitarnego transferu czasu i częstotliwości oraz do światłowodowej dystrybucji częstotliwości op	500	4	4	1	5	9											n	EM0		NIE	FAŁSZ	NIE	0	Platforma do instalacji anten GNSS - z łatwym dostępem, - z zapewnioną widocznością saltelitów GNSS (pod kątem elewacji powyżej 20 stopni powinna być otwarta przestrzeń - bez przeszkód w widoczności satelitów), - z zapewnionym kanałem wewnątrz budynku do
PRAWDA	L2_5	stanowiska pomiarowo badawcze do wzorcowania przyrządów z dziedziny czasu i częstotliwości	1000	5	4	3	67	15	20	T0	1000000	50	5	1000000		1000000	230	3	n	EM0		NIE	FAŁSZ	kable koncentryczne do transmisji wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości	2	Najlepiej w bezpośredniej bliskości pomieszczenia pomiarów, dystrybucji i transferu czasu i częstotliwości oraz pomieszczenia zegarów atomowych - konieczność doprowadzenia wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości na stanowisko. Zapewnienie ciągłości zas
PRAWDA	L2_6	stanowisko państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości (w tym: zegary atomowe, systemy do pomiarów, dystrybucji i transferu czasu metodami satelitarnymi i światłowodowymi, akumulatornia - zasilanie rezerwowe, platforma antenowa)	2000	6	5	3	345	30	20	T0	1000000	50	5	1000000		1000000	230	5	w	EM0		NIE	FAŁSZ	światłowodowa i kable koncentryczne do transmisji wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości	4	Stanowisko to docelowo będzie składało się z pomieszczeń: POMIESZCZENIE ZEGARÓW ATOMOWYCH, POMIESZCZENIE POMIARÓW, DYSTRYBUCJI I TRANSFERU CZASU I CZĘSTOTLIWOŚC, PLATFORMA ANTENOWA wraz z pomieszczeniem pomocniczym - już projektowanych dla potrzeb STANOWI
FAŁSZ	L3_1	stanowisko do badania czujników konduktometrycznych stosowanych do pomiarów wody czystej i ultraczystej	500	3	3	3	1	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	10	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	nie	2	
FAŁSZ	L3_2	stanowisko do badania aktywności jonów elektrolitu	400	3	3	3	3	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	5	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	nie	2	
PRAWDA	L3_3	stanowisko do badania czystości gazów energetycznych m.in. metanu, wodoru	200	6	6	3	16	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	5	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	wentylacja mechaniczna	1,5	
PRAWDA	L3_4	stanowisko do badania jakości biogazu i innych biopaliw gazowych	200	6	6	3	17	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	5	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	wentylacja mechaniczna	2	
FAŁSZ	L3_5	stanowisko do badania jakości biopaliw ciekłych (bioetanol)	500	3	3,5	3	1	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	5	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	nie	1	
FAŁSZ	L3_6	stanowisko do badania składników toksycznych technikami sprzężonymi: GC-ICP-MS, HPLC-ICP-MS	1000	5	3,5	3	2	15	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	10	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	dygestorium, instalacja argonowa	2	
FAŁSZ	L3_7	wzorzec odniesienia jednostki miary liczby falowej w zakresie podczerwieni	200	4	3	3	12	0	20	T1	1000000	50	10	C		45	230	5	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	nie	1	
FAŁSZ	L3_8	rozbudowane stanowisko preparatywno-przygotowawcze	300	8	8	3	11	10	23	T0	1000000	50	10	B	V0	45	380	15	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	dygestorium	0	
FAŁSZ	L3_9	stanowisko do badania stopnia zanieczyszczeń powietrza związkami szkodliwymi cz I	250	6	6	3	15	5	23	T0	1000000	50	10	C		45	380	5	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	wentylacja mechaniczna	2	
FAŁSZ	L3_10	stanowisko do ważenia substancji stałych i roztworów	200	5	5	3	10	0	23	T0	1000000	50	10	B	V0	45	230	5	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	nie	0	
PRAWDA	L3_11	magazyn butli gazowych stanowisko powiązane z pracownią analizy gazów	8000	15	15	4		0	20	T0	1000000	50	10	C		45	230	5	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	wentylacja mechaniczna		magazyn butli - osobny budynek połączony funkcjonalnie z pracownią Analizy Gazów
PRAWDA	L3_12	stanowisko do wytwarzania i odtwarzania gazowych wzorców odniesienia (oraz magazyn butli gazowych) cz I	100	5	8	3	13	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	380	5	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	wentylacja mechaniczna	2	
PRAWDA	L3_13	stanowisko do wytwarzania i odtwarzania gazowych wzorców odniesienia (oraz magazyn butli gazowych) cz II	150	4	5	3	14	5	20	T1	1000000	50	10	C	V0	45	230	5	w	EM0	40	nie	FAŁSZ	wentylacja mechaniczna		
FAŁSZ	L3_14	stanowisko do analiz chemicznych metodą miareczkowania	200	1,5	3	3	8	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	5	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	nie	1	
FAŁSZ	L3_15	stanowisko do oznaczania jonów metodą chromatografii jonowej - przyszły wzorzec państwowy jednostki miary liczności materii (mol) (2)	150	2,5	3	3	9	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	5	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	nie	2	
FAŁSZ	L3_16	stanowisko do precyzyjnych analiz kulometrycznych - przyszły wzorzec państwowy jednostki miary liczności materii (mol) (1)	300	2,5	3	3	8	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	10	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	dygestorium, instalacja argonowa	1	
FAŁSZ	L3_17	zmodernizowane stanowiska do przekazywania jedności miary pH	250	2	3	3	4	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	10	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	nie	1	
FAŁSZ	L3_18	zmodernizowane stanowiska do przekazywania jedności miary przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów (konduktometry, czujniki konduktometryczne)	300	2	3	3	7	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	10	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	nie	1	
FAŁSZ	L3_19	zmodernizowane stanowiska do przekazywania jednostki miary pH (pehametry, elektrody pH, symulatory pH)	500	2	3	3	5	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	10	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	nie	1	
FAŁSZ	L3_20	zmodernizowane stanowisko do badania czystości gazów	200	4	6	3	19	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	5	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	wentylacja mechaniczna	1,5	
FAŁSZ	L3_21	zmodernizowany państwowy wzorzec jednostki miary pH	400	3	3	2	4	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	5	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	nie	2	
FAŁSZ	L3_22	zmodernizowany państwowy wzorzec jednostki przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów	500	3	3	3	6	0	23	T0	1000000	50	10	C	V0	45	230	10	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	nie	1	
FAŁSZ	L3_23	rozbudowany wzorzec odniesienia GUM zawartości składnika w roztworze	500	5	3	3	9	5	20	T1	1000000	50	10	C		45	230	10	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	dygestorium, instalacja argonowa	2	
FAŁSZ	L3_24	zmodernizowane stanowisko do przekazywania jedności miary przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów (metoda wtórna, materiały odniesienia)	500	3	3	3	6	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	10	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	nie	1	
FAŁSZ	L3_25	zmodernizowane stanowisko do przekazywania jednostki zawartości składnika w mieszaninie gazowej metodą chromatograficzną	250	6	10	3	18	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	10	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	wentylacja mechaniczna	2,5	
FAŁSZ	L3_26	zmodernizowane stanowisko do przekazywania jednostki zawartości składnika w mieszaninie gazowej przy użyciu analizatorów gazów	200	5	6	3	20	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	380	5	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	wentylacja mechaniczna	2,5	
PRAWDA	L3_27	stanowisko przygotowawcze	500	7	3,5	3	1	15	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	10	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	dygestorium	2	
PRAWDA	L3_28	stanowisko do badania zanieczyszczeń żywności technikami sprzężonymi GC-MS/MS	1000	5	3,5	3	1	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	10	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	dygestorium	2	
PRAWDA	L3_29	stanowisko do badania zanieczyszczeń żywności technikami sprzężonymi LC-MS/MS	1000	5	3,5	3	1	0	23	T0	1000000	50	10	C		45	230	10	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	dygestorium	2	
PRAWDA	L3_30	stanowisko do ważenia substancji stałych i roztworów	400	5	5	3	1	0	23	T0	1000000	50	10	B	V0	45	230	10	w	EM0	40	tak	FAŁSZ	nie	0	
PRAWDA	L4_1	Generator małych kątów o rozdzielczości 0,001" i zakresie pomiarowym co najmniej 1°	500	5	5	3	1	15	20	T2	15	47,5	7,5	C	V2	45	230	5	w	EM0	1000000	NIE	PRAWDA	NIE	0,75	wejście przez "śluzę"; zasilanie awaryjne
PRAWDA	L4_2	Stanowisko do badania kwarcowych płytek kontrolnych (sprawdzanie czystości optycznej, płaskości, równoległości powierzchni, błędów osi optycznej)	500	5	4	3	2	5	20	T1	15	47,5	7,5	C	V0	45	230	5	w	EM0	1000000	NIE	FAŁSZ	NIE	0,7	wejście przez "śluzę"
PRAWDA	L4_3	Stanowisko pomiarowe do pomiarów dużych obiektów 3D	100	12	12	4	7	0	20	T1	15	50	5	C	V1	45	230	5	w	EM1		NIE	FAŁSZ	NIE	1,7	zasilanie awaryjne
PRAWDA	L4_4	Stanowisko pomiarowe nanometrologii wymiarowej	300	7	4	3	6	12	20	T2	15	50	5	ISO4	V2	45	230	5	w	EM1		NIE	PRAWDA	NIE	1,7	clean room, wejście przez "śluzę"; zasilanie awaryjne
FAŁSZ	L4_5	Stanowiska pomiarowe do wzorcowań wykonywanych na zewnątrz	100	5	5	3		0				50		1000000		1000000				EM0		NIE	FAŁSZ	NIE	1	Stanowska pomiarowe do wzykonywanie wzorcowań na zawnątrz (komparatory dwuczujnikowe, CMM, płyty pomiarowe, goniometry, maszyny 1-D)
PRAWDA	L4_6	Stanowisko pomiarowe - baza geodezyjna (na zewnątrz)		500	3			0															FAŁSZ		1	Stanowisko do umieszczenia na zewnątrz budynku (co 50 metrów betonowe słupki umieszczone wzdłóż najdłuższej krawędzi działki)
FAŁSZ	L4_7	Stanowisko pomiarowe do kwarcowych płytek kontrolnych, o niepewności rozszerzonej wyznaczenia wartości kąta skręcenia nie większej, niż 0,001°	500	0	0	3	2	0	20	T1	15	47,5	7,5	C	V0	45	230	5	w	EM0	1000000	NIE	FAŁSZ	NIE	1	wejście przez "śluzę"
FAŁSZ	L4_8	Stanowisko pomiarowe do wyznaczania wartości współczynnika załamania światła stałych i ciekłych wzorców refraktometrycznych, w różnych długościach fal, na bazie precyzyjnego stołu obrotowego	900	3	4	3	3	10	20	T1A/T3	15	47,5	7,5	C	V2	45	230	10	w	EM0	1000000	TAK	PRAWDA	wyciąg	1	bliźniacze pomieszczenie obok, ok. 10 m2, oddzielone przezroczystą ścianą, wejście przez śluzę; konieczność ustawiania temperatury z zakresu (15 ÷ 25) °C z dokładnością ± 0,1 °C
PRAWDA	L4_9	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorców kreskowych 2D – komparator interferencyjny	500	0	0	3	6	0	20	T2	15	50	5	ISO4	V2	45	230	5	w	EM1		NIE	PRAWDA	NIE	1	wejście przez "śluzę"; zasilanie awaryjne
FAŁSZ	L4_10	Nowe stanowisko do pomiaru chropowatości - profilometr optyczny	300	0	0	3	6	0	20	T2	15	50	5	ISO4	V2	45	230	5	w	EM1		NIE	PRAWDA	NIE	0,75	wejście przez "śluzę"; zasilanie awaryjne
FAŁSZ	L4_11	Stanowisko pomiarowe - multisensorowa maszyna pomiarowa	300	0	0	3	7	0	20	T1	15	50	5	C	V1	45	230	5	w	EM1		NIE	PRAWDA	NIE	0,75	zasilanie awaryjne
FAŁSZ	L4_12	Nowe stanowisko do pomiaru odchylenia od okrągłości	300	0	0	3	7	0	20	T1	15	50	5	C	V1	45	230	5	w	EM1		NIE	PRAWDA	NIE	0,65	zasilanie awaryjne
FAŁSZ	L4_13	Nowe stanowisko do pomiaru płaskości - interferometr laserowy	500	3	5	3	12	0	20	T1	15	50	10	C	V2	55	230	3	w	EM1		NIE	PRAWDA	NIE	0,5	
FAŁSZ	L4_14	Nowe stanowisko do wzorcowania płytek kątowych i pryzm wielościennych	50	3	3	3	5	10	20	T1	20	47,5	7,5	C	V0	45	230	5	w	EM0	1000000	NIE	FAŁSZ	NIE	0,75	dodatkowe pomieszczenie, ok. 10 m2, z wentylacją/wyciągiem, do przygotowywania wzorców do pomiarów

FAłSZ	L4_15	Nowe stanowisko pomiarowe do wzorcowania refraktometrów wizualnych i fotoelektrycznych	100	5	5	3	4	15	20	T1	20	47,5	7,5	C		45	230	5	w	EM0	1000000	TAK	FAłSZ	wyciąg	0,75	dodatkowe pomieszczenie, ok. 15 m2, w sąsiedztwie na pokój "wagowy" i do destylacji wody
FAłSZ	L4_16	Nowe stanowisko pomiarowe do wzorcowania długich płytek wzorcowych i wzorców średnicy - maszyna pomiarowa 1-D	800	4	36	3	10	0	20	T2	15	50	10	C	V2	55	230	3	w	EM1		NIE	PRAWDA	NIE	0,4	
FAłSZ	L4_17	Nowe stanowisko pomiarowe do wzorcowania długich płytek wzorcowych metodą interferencyjną	700	4	6	3	10	0	20	T2	15	50	5	C	V2	55	230	3	w	EM1		NIE	PRAWDA	NIE	0,3	
FAłSZ	L4_18	Nowe stanowisko pomiarowe do wzorcowania płytek wzorcowych metodą interferencyjną	600	4	6	3	11	12	20	T2	15	50	10	C	V2	55	230	3	w	EM1		NIE	PRAWDA	NIE	0,5	w powierzchni pomocniczej dygestorium
FAłSZ	L4_19	Nowe stanowisko pomiarowe do wzorcowania polarymetrów fotoelektrycznych	10	0	0	3	4		20	T1	20	47,5	7,5	C		45	230	5	w	EM0	1000000	TAK	FAłSZ	wyciąg	1	oświetlenie o ograniczonej emisji ciepła
FAłSZ	L4_20	Nowe stanowisko pomiarowe do wzorcowania pryzm wielościennych, płytek kątowych przywieralnych i podziałek kątowych	700	0	0	3	1	0	20	T2	15	47,5	7,5	C	V2	45	230	5	w	EM0	1000000	NIE	PRAWDA	NIE	0,75	wejście przez "śluzę"; zasilanie awaryjne
FAłSZ	L4_21	Nowe zautomatyzowane stanowisko pomiarowe do wzorcowania zespołu kompensacji długości fali w powietrzu oraz czujników temperatury	300	3	5	3	10	0	20	T1	30	50	10	C		55	230	5	w	EM1		NIE	FAłSZ	NIE	0,3	
FAłSZ	L4_22	Stanowisko pomiarowe do badań stabilizowanych laserów metrologicznych	400	6	6	3	9	9	20	T2	15	50	10	C	V2	55	230	5	w	EM1		NIE	PRAWDA	NIE	1,25	
FAłSZ	L4_23	Zautomatyzowany komparator interferencyjny o zakresie pomiarowym 50 m	500	60	3	0	8	0	20	T1	20	50	5	C	V1	45	230	5	w	EM1	1000000	NIE	FAłSZ	NIE	1,5	Możliwość wprowadzenia do pomieszczenia przyrządów o długości co najmniej 5 m; zasilanie awaryjne
PRAWDA	L4_24	Stanowisko - pomiary w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem symulatorów dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów drogowych	200	80	10	3,5	13	20	20		21	60	35	1000000		1000000	230	5	w		2	NIE	FAłSZ	wzorcowy sygnał częstotliwości	3	
PRAWDA	L4_25	Stanowisko badawcze do narażeń klimatycznych typu walk-in (pomieszczenie biurowe dla obsługi)	2800	6	4,5	3,5	5	5	25	T0	21	50	25	1000000		1000000	380	50	w	EM0		TAK	PRAWDA	odprowadzanie ciepła na zewnątrz	0,5	3 5 7
PRAWDA	L4_26	Stanowiska badawcze do badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz pomiaru emisji (pomieszczenie biurowe dla obsługi)	150	5	3	3,5	14	20	20		21	60	35	1000000		1000000	380	20	w	EM0	2	NIE	FAłSZ	wzorcowy sygnał częstotliwości	1,5	3 5 7
PRAWDA	L4_27	Stanowisko badawcze do narażeń klimatycznych do szoków termicznych (pomieszczenie biurowe dla obsługi)	1500	5	4	3,5	15	5	25	T0	21	50	25	1000000		1000000	380	27	w	EM0		TAK	PRAWDA		0,5	3 5 7
PRAWDA	L4_28	Stanowisko badawcze do badania stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP5X. IP6X) przed przedostawaniem się ciał stałych, wnikaniem pyłu oraz przed dotykiem bezpośrednim części czynnych (pomieszczenie biurowe dla obsługi)	550	5	3	3,5	16	3	25	T0	21	50	25	1000000		1000000	230	2,3	w	EM0		NIE	PRAWDA		0,5	3 5 7
PRAWDA	L4_29	Stanowisko badawcze do badania stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IPX1,IPX2,IPX3,IPX4) przed , wnikaniem wody (pomieszczenie biurowe dla obsługi)	690	5	4	3,5	16	3	25	T0	21	50	25	1000000		1000000	380	0,7	w	EM0		TAK	FAłSZ		0,5	3 5 7
PRAWDA	L4_30	Stanowisko badawcze do badania stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy przed ogniem (pomieszczenie biurowe dla obsługi)	33	1	2	3,5	16	3	25	T0	21	50	25	1000000		1000000	230	0,5	w	EM0		NIE	FAłSZ		0,5	3 5 7
PRAWDA	L4_31	Stanowisko pomiarowe do badania tachografów samochodowych.	40	5	3	3,5	17	10	20	T0	21	60	35	1000000		1000000	230	5	w	EM0	2	NIE	FAłSZ	wzorcowy sygnał częstotliwości	0,25	
PRAWDA	L4_32	Stanowisko pomiarowe do badania taksometrów niezainstalowanych w taksówce.	40	5	3	3,5	18	10	20	T0	21	60	35	1000000		1000000	230	5	w	EM0	2	NIE	FAłSZ	wzorcowy sygnał częstotliwości	1	
PRAWDA	L4_33	Stanowisko pomiarowe do badania w warunkach laboratoryjnych przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.	60	5	3	3,5	19	10	20	T0	21	60	35	1000000		1000000	230	5	w	EM0	2	NIE	FAłSZ	wzorcowy sygnał częstotliwości	2	
PRAWDA	L4_34	Stanowisko pomiarowe do badania wykresówek do tachografów samochodowych.	40	5	3	3,5	20	10	20	T0	21	60	35	1000000		1000000	230	5	w	EM0	2	NIE	FAłSZ	NIE	0,5	
PRAWDA	L4_35	Stanowisko badawcze do narażeń klimatycznych (pomieszczenie biurowe dla obsługi)	1600	6	4	3,5	21	5	25	T0	21	50	25	1000000		1000000	380	26	w	EM0		TAK	PRAWDA	woda destylowana	0,5	3 5 7
PRAWDA	L4_36	Stanowisko badawcze do narażeń mechanicznych (pomieszczenie biurowe dla obsługi)	2700	6	5	3,5	21	5	25	T0	21	50	25	1000000		1000000	380	42,5	w	EM0		NIE	PRAWDA	odprowadzanie ciepła na zewnątrz	0,5	3 5 7
PRAWDA	L5_1	Stanowisko do badania baterii paliwowowodorowych i innych baterii do zasilania pojazdów elektrycznych	1000	12	30	12	25	15	23	T0	1000000	50	10	Klasa 7	V0		400	100	w	EM0	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	1	
PRAWDA	L5_2	Stanowisko do badania na napędów pojazdów elektrycznych	1000	18	30	12	25	15	23	T0	1000000	50	10	Klasa 7	V0		400	100	w	EM0	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	1	
PRAWDA	L5_3	Stanowisko do badania i wzorcowania analizatorów i innych przyrzadów do pomiarów parametrów sieci enegetycznej	500	10	15	3	23	15	23	T0	1000000	50	10	Klasa 7	V0		400	50	w	EM1	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	1	
PRAWDA	L5_4	Stanowisko do badania liczników energii prądu stałego	1000	0	0	0	24	15	23	T0	1000000	50	10	Klasa 7	V0		400	50	w	EM1	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	1	
PRAWDA	L5_5	Stanowisko do badania baterii i instalacji solarnych	1000	0	0	0	26	15	23	T0	1000000	50	10	Klasa 7	V0		400	100	w	EM0	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	1	Oprócz zamkniętego pomieszczenia na stanowisko pomiarowe wymadana jest otwarta, wywównana i utwardzona przestrzeń na zewwnątrz (nasłonecznienie wschód-południe) o wymiarach ok. 10 m x 10 m, na której będą stały ogniwa solarne.
FAłSZ	L5_6	Stanowisko wzorca kwantowego napięcia przemiennego cz. 2	500	10	5	3,5	8	20	23	T3	1000000	45	15	Klasa 6	V0	55	230	5	w	EM2	0	TAK	PRAWDA	tak ciekłego helu	0,4	Pomieszczenie stanowiska sąsiadujące z pomieszczeniem stanowiska pomiarowe do wzorcowania przetworników termicznych AC.DC i kalibratorów Śluza wiodący do pomieszczeń laboratoryjnych ok. 2m x 3m . Dwuskrzydłowe drzwi wejściowe z korytarza i śluzy oraz dw
FAłSZ	L5_7	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania liczników energii.	500	10	10	3	10	15	23	T0	0	50	10	Klasa 7	V0	10	400	50	w	EM0	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	0,33	
FAłSZ	L5_8	Stanowisko badawcze do badania emisji i odporności w komorze GTEM	1500	10	5	4	21	25	23	T0	1000000	50	0,2	1000000	V0	55	400	10	w	EM1	0	TAK	PRAWDA	Oświetlenie działające na wysokiej częstotliwości (40 kHz). Dla zasilania THD < 3%.	0,25	
PRAWDA	L5_9	Stanowisko badawcze do badania odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne	100000	30	21	15	19	30	23	T0	200	50	0,3	1000000	V0	55	400	30	w	EM1	0	TAK	PRAWDA	oświetlenie działające na wysokiej częstotliwości (40 kHz). Dla zasilania THD < 3%.	0,25	ekranowanie dla fal płaskich do 20 GHz
FAłSZ	L5_10	Stanowisko badawcze do badania odporności na zaburzenia elektryczne i magnetyczne.	200	10	10	4	20	10	23	T0	1000000	50	0,2	1000000	V0	55	400	10	w	EM1	0	NIE	FAłSZ	Oświetlenie działające na wysokiej częstotliwości (40 kHz). Dla zasilania THD < 3%.	0,25	
FAłSZ	L5_11	Stanowisko badawcze do badania odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej	200	7	4	4	22	10	23	T0	1000000	50	0,2	1000000	V0	55	400	10	w	EM1	0	NIE	FAłSZ	Oświetlenie działające na wysokiej częstotliwości (40 kHz). Dla zasilania THD < 3%.	0,25	
FAłSZ	L5_12	Stanowisko do wzorcowania wyposażenia pomiarowego w.cz. w paśmie do 40 GHz	200	6	4	4	15	40	23	T0	1000000	50	20	1000000	V0		230	8	n	EM1	1000000	NIE	FAłSZ	NIE	1	
FAłSZ	L5_13	Stanowisko pomiarowe do badania liczników energii.	500	10	10	3	11	15	23	T0	0	50	10	Klasa 7	V0	10	400	50	w	EM1	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	0,33	
FAłSZ	L5_14	Stanowisko pomiarowe do badania oddziaływania wielkości wpływających na błędy liczników energii	500	8	8	3	11	15	23	T0	0	50	10	Klasa 7	V0	10	400	50	w	EM1	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	0,33	
FAłSZ	L5_15	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania cewek indukcyjnych, kondensatorów i rezystorów	100	5	5	3,5	9	30	23	T3	1000000	45	15	Klasa 7	V0	55	230	10	w	EM2	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	1	wszystkie stanowiska RLC w jednym pomieszczeniu, filtrowanie zakłóceń w sieci zasilającej energetycznej
FAłSZ	L5_16	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania kalibratorów	200	5	4	3,5	6	20	23	T0	1000000	45	25	Klasa 7	V0	55	400	10	w	EM1	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	1	Pomieszczenia stanowisk pracowni w pomieszczeniach obok siebie oraz dwuskrzydłowe drzwi między sąsiadującymi pomieszczeniami, filtrowanie zakłóceń w sieci zasilającej energetycznej.
FAłSZ	L5_17	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania kompensatorów i ogniw Westona	200	3	4	4	4	0	23	T3	1000000	45	15	Klasa 6	V0	55	230	3	w	EM2	0	TAK	PRAWDA	NIE	0,4	
FAłSZ	L5_18	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania mierników natężenia pola elektrycznego poniżej 100 kHz	100	7	5	5	16	15	23	T0	1000000	50	0,1	1000000	V0	55	230	10	n	EM1,EM2	0	NIE	FAłSZ	Oświetlenie działające na wysokiej częstotliwości (40 kHz). Dla zasilania THD < 3%.	1	ekranowanie dla fal płaskich do 20 GHz, brak elementów ferromagnetycznych w konstrukcji laboratorium oraz najbliższym otoczeniu, oddzielny budynek, im dalej od linii PKP tym lepiej

FAłSZ	L5_19	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania mierników natężenia pola elektrycznego powyżej 100 kHz	100	7	5	5	17	15	23	T0	1000000	50	0,1	1000000	V0	55	230	10	n	EM1,EM2	0	NIE	FAłSZ	Oświetlenie działające na wysokiej częstotliwości (40 kHz). Dla zasilania THD < 3%.	1	ekranowanie dla fal płaskich do 20 GHz, brak elementów ferromagnetycznych w konstrukcji laboratorium oraz najbliższym otoczeniu, oddzielny budynek, im dalej od linii PKP tym lepiej
FAłSZ	L5_20	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania mierników natężenia pola magnetycznego poniżej 100 kHz	200	7	5	5	18	15	23	T0	1000000	50	0,2	1000000	V0	55	230	10	n	EM1,EM2	0	NIE	FAłSZ	Oświetlenie działające na wysokiej częstotliwości (40 kHz). Dla zasilania THD < 3%.	1	ekranowanie dla fal płaskich do 20 GHz, brak elementów ferromagnetycznych w konstrukcji laboratorium oraz najbliższym otoczeniu, oddzielny budynek, im dalej od linii PKP tym lepiej
FAłSZ	L5_21	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania mostków do pomiarów błędów przekładników, obciążeń przekładników	500	6	6	3	13	15	23	T0	0	50	10	Klasa 7	V0	10	400	50	w	EM0	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	0,25	
FAłSZ	L5_22	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania multimetrów cyfrowych	200	5	4	3,5	6	20	23	T0	1000000	45	25	Klasa 7	V0	55	400	10	w	EM1	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	1	Pomieszczenia stanowisk pracowni w pomieszczeniach obok siebie oraz dwuskrzydłowe drzwi między sąsiadującymi pomieszczeniami, filtrowanie zakłóceń w sieci zasilającej energetycznej.
FAłSZ	L5_23	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania przekładników napięciowych	11000	30	30	20	12	15	23	T0	0	50	10	Klasa 7	V0	10	400	200	w	EM0	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	0,25	
FAłSZ	L5_24	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania przekładników prądowych	1500	20	10	20	12	15	23	T0	0	50	10	Klasa 7	V0	10	400	200	w	EM0	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	0,25	
FAłSZ	L5_25	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania przetworników termicznych AC.DC i kalibratorów	200	5	5	3,5	7	20	23	T3	1000000	45	25	Klasa 7	V0	55	400	10	w	EM2	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	2	Pomieszczenia stanowisk pracowni w pomieszczeniach obok siebie oraz dwuskrzydłowe drzwi między sąsiadującymi pomieszczeniami, filtrowanie zakłóceń w sieci zasilającej energetycznej.
FAłSZ	L5_26	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania przyrządów do pomiaru rezystancji, indukcyjności i pojemności elektrycznej	100	5	5	3,5	9	30	23	T3	1000000	45	15	Klasa 7	V0	55	230	10	w	EM2	0	NIE	PRAWDA	przeciwpożarowe	1	wszystkie stanowiska RLC w jednym pomieszczeniu, filtrowanie zakłóceń w sieci zasilającej energetycznej.
FAłSZ	L5_27	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania rezystorów wysokoomowych	200	3	4	4	3	0	23	T3	1000000	45	15	Klasa 6	V0	55	230	5	w	EM2	0	TAK	PRAWDA	NIE	0,4	
FAłSZ	L5_28	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania rezystorów wzorcowych	200	3	4	4	2	0	23	T3	1000000	45	15	Klasa 6	V0	55	230	6	w	EM2	0	TAK	PRAWDA	NIE	0,4	
FAłSZ	L5_29	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania woltomierzy cyfrowych niskich częstotliwości	100	5	3	3,5	6	20	23	T0	1000000	45	25	Klasa 7	V0	55	230	10	w	EM1	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	1	Pomieszczenia stanowisk pracowni w pomieszczeniach obok siebie oraz dwuskrzydłowe drzwi między sąsiadującymi pomieszczeniami, filtrowanie zakłóceń w sieci zasilającej energetycznej.
FAłSZ	L5_30	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania woltomierzy wysokiego napięcia	500	10	10	20	12	15	23	T0	0	50	10	Klasa 7	V0	10	400	50	w	EM0	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	0,25	
FAłSZ	L5_31	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorca państwowego i wzorców odniesienia jednostki miary indukcyjności	100	5	5	3,5	9	30	23	T3	1000000	45	15	Klasa 7	V0	55	230	10	w	EM2	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	1	wszystkie stanowiska RLC w jednym pomieszczeniu, filtrowanie zakłóceń w sieci zasilającej energetycznej
FAłSZ	L5_32	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorca państwowego i wzorców odniesienia jednostki miary pojemności elektrycznej	50	5	5	3,5	9	30	23	T3	1000000	45	15	Klasa 7	V0	55	230	10	w	EM2	0	NIE	FAłSZ	przeciwpożarowe	1	wszystkie stanowiska RLC w jednym pomieszczeniu, filtrowanie zakłóceń w sieci zasilającej energetycznej
FAłSZ	L5_33	Stanowisko pomiarowe państwowego wzorca jednostki miary rezystancji	500	5	5	4	1	15	23	T3	1000000	45	15	Klasa 6	V0	55	230	10	w	EM2	0	TAK	PRAWDA	tak ciekłego helu	0,4	wymaga oddzielnego pomieszczenia ========== Uwaga: dot wszystkich stanowisk jeżeli nie zapisano inaczej: - drgania wg ISO 10816-1:1995 - ekranowanie 100 dB dla fal płaskich do 20 GHz - czystość powietrza wg PN-EN ISO 14644-1:2016
FAłSZ	L5_34	Stanowisko pomiarowe państwowego wzorca jednostki napięcia elektrycznego stałego oraz do wzorcowania półprzewodnikowych źródeł napięcia	500	5	4	4	5	0	23	T3	1000000	45	15	Klasa 6	V0	55	230	5	w	EM2	0	TAK	PRAWDA	tak ciekłego helu	0,4	wymaga oddzielnego pomieszczenia, niezbędny sygnał o wzorcowej częstotliwości
FAłSZ	L5_35	Stanowisko wzorca kwantowego napięcia przemiennego cz. 1	500	7	5	3,5	8	20	23	T3	1000000	45	15	Klasa 6	V0	55	230	5	w	EM2	40	TAK	PRAWDA	tak ciekłego helu	0,4	Pomieszczenie stanowiska sąsiadujące z pomieszczeniem stanowiska pomiarowe do wzorcowania przetworników termicznych AC.DC i kalibratorów. Śluza wiodący do pomieszczeń laboratoryjnych ok. 2m x 3m . Dwuskrzydłowe drzwi wejściowe z korytarza i śluzy oraz
PRAWDA	L6_1	stanowisko widmowego współczynnka odbicia metodą spektrogoniofotometryczną w zakresie UV-VIS-NIR	100	5	6	3,5	8	0	23	T0	1000000	40	20	ISO 6		45	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno.
PRAWDA	L6_2	Badawcze stanowisko pomiarowe do badania czytników absorpcyjnych i ich kontrolnych filtrów	200	6	5	3,5	13	0	23	T0	45	50	25	ISO 6		55	380	5	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,8	Pomiędzy pomieszczeniami dodatkowe drzwi przesuwne
PRAWDA	L6_3	stanowisko badania densytometrów i spektrodensytometrów	8	3	5	3,5	10	0	23	T0	1000000	40	20	ISO 6		45	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
PRAWDA	L6_4	stanowisko do wytwarzania wzorców achromatrycznych i barwnych	80	5	4	3,5	9	0	23	T0	1000000	40	20	ISO 6		45	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także które składać się będzie z dwóch (może trzech) pieców do wyprażania wzorców z teflonu (w około 250-300 stopn
FAłSZ	L6_5	analiza transmisji światła w przestrzeni innej niż powietrze	850	4	4	5	6	3	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	1	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_6	badania podstawowe	1000	6	5	5	6	4	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	1	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_7	badanie oraz określanie charakterystyk metrologicznych źródeł LED	1000	4	3	5	6	3	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_8	badanie parametrów fizycznych laserów dużych mocy	2000	8	5	5	7	4	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	1	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_9	Badawcze stanowisko pomiarowe do badania wzorców i przyrządów spektrofotometrycznych nowej generacji.	200	6	5	3,5	16	0	23	T0	45	50	25	ISO 6		55	380	5	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,8	
FAłSZ	L6_10	Badawcze stanowisko pomiarowe do badania wzorców spektrofotometrycznych barwnych posiadających wyraźną krawędź absorpcji w obszarze widzialnym (tzw. filtry odcinające)	200	6	5	3,5	15	0	23	T0	45	50	25	ISO 6		55	380	5	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,6	Pomiędzy pomieszczeniami dodatkowe drzwi przesuwne
FAłSZ	L6_11	Badawcze stanowisko pomiarowe do badania wzorców spektrofotometrycznych charakteryzujących się większym zakresem widmowym i większym zakresem fotometrycznym	200	6	5	3,5	14	0	23	T0	45	50	25	ISO 6		55	380	5	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,6	Pomiędzy pomieszczeniami dodatkowe drzwi przesuwne
FAłSZ	L6_12	stanowisko badania spektrofotometrów i kolorymetrów odbiciowych nowej generacji (wielokątowych).	10	3	5	3,5	10	0	23	T0	1000000	40	20	ISO 6		45	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_13	doświadczalne stanowisko radiometryczne	1000	4	3	5	3	0	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_14	odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary temperatury barwowej oraz wzorcowanie kolorymetrów trójchromatycznych	500	3	3	5	1	0	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_15	stanowisko współczynnika luminancji w geometrii 0:45	10	3	4	3,5	12	0	23	T0	1000000	40	20	ISO 6		45	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_16	stanowisko współczynnika luminancji w geometrii 45:0	10	3	4	3,5	12	0	23	T0	1000000	40	20	ISO 6		45	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_17	stanowisko współczynnika luminancji w geometrii d:0	25	3	5	3,5	11	0	23	T0	1000000	40	20	ISO 6		45	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_18	stanowisko współczynnika luminancji w geometrii d:8	20	3	5	3,5	11	0	23	T0	1000000	40	20	ISO 6		45	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_19	badania metrologiczne przyrządów stosowanych w obiektywnej ocenie cech fizycznych związanych z postrzeganiem wzrokowym	450	3	4	5	5	3	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_20	badanie materiałów fotoluminescencyjnych część pomiarowa	600	3	3	5	1	0	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_21	badanie materiałów fotoluminescencyjnych część technologiczna	600	3	2	5	2	0	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,25	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także

FAłSZ	L6_22	ocena metrologiczna fotometrycznych przyrządów pomiarowych	500	12	4	5	1	0	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_23	ocena metrologiczna mierników nadfioletu stosowanych w badaniach NDT	1000	2	2	5	2	0	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_24	ocena metrologiczna mierników światła białego stosowanych w badaniach NDT	1000	2	2	5	2	0	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,25	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_25	odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary czułości widmowej przy wybranych długościach fali promieniowania laserowego	1000	4	4	5	2	0	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_26	odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary czułości widmowej w zakresie widmowym (380 – 1600) nm	1200	5	3	5	3	8	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_27	odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary strumienia świetlnego (wzorzec państwowy)	500	5	5	5	1	5	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_28	odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary światłości (wzorzec państwowy)	700	10	4	5	2	10	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_29	stabilizacja parametrów świetlnych i elektrycznych źródeł przeznaczonych na wzorce fotometryczne	500	4	3	5	4	2	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,2	
FAłSZ	L6_30	stanowisko do badania spektrofotometrów i kolorymetrów odbiciowych	10	3	4	3,5	12	0	23	T0	1000000	40	20	ISO 6		45	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,4	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_31	stanowisko doświadczalne testowania i sprawdzania przyrządów pomiarowych	600	2	3	5	2	0	22	T0	1000000	40	25	ISO 6		55	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,3	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
FAłSZ	L6_32	Stanowisko pomiarowe do badania spektrofotometrów absorpcyjnych UV, VIS, NIR przy użyciu filtrów wzorcowych.	200	6	5	3,5	19	0	23	T0	45	50	25	ISO 6		55	380	5	w	EM0	40	NIE	FAłSZ	NIE	0,6	Pomiędzy pomieszczeniami dodatkowe drzwi przesuwne
FAłSZ	L6_33	Stanowisko pomiarowe do badania wzorców spektrofotometrycznych z udziałem wzorca wtórnego.	200	6	5	3,5	18	20	23	T0	45	50	25	ISO 6		55	380	5	w	EM0	40	NIE	FAłSZ	NIE	0,7	Docelowo - Stanowisko robocze do przekazywania jednostki widmowego współczynnika przepuszczania od wzorca państwowego, Pomiędzy pomieszczeniami dodatkowe drzwi przesuwne
FAłSZ	L6_34	Stanowisko pomiarowe do badania wzorców widmowego współczynnika przepuszczania i składowych trójchromatycznych w odniesieniu do wzorca pierwotnego.	200	6	5	3,5	17	20	23	T0	45	50	25	ISO 5		55	380	5	w	EM0	40	NIE	PRAWDA	instalacja z nawiewami laminarnymi powietrza	0,9	Docelowo - Stanowisko wzorca państwowego widmowego współczynnika przepuszczania, Pomiędzy pomieszczeniami dodatkowe drzwi przesuwne
FAłSZ	L6_35	stanowisko współczynnika odbicia w geometrii 8:d	100	4	5	3,5	11	0	23	T0	1000000	40	20	ISO 6		45	380	10	w	EM0	50	TAK	FAłSZ	NIE	0,4	pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zasłonięte metalowymi żaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat także
PRAWDA	L7_1	Badawcze stanowisko pomiarowe cieczy nienewtonowskich i wiskozymetrów rotacyjnych	300	10	10	4	3	15	20	T1	1000000	50	5	1000000	V0	45	230	4	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	wentylacja z klimatyzacją i dygestorium	1	
PRAWDA	L7_2	państwowy wzorzec ciśnienia	10	7	7	4		0	20	T1	20	50	10	ISO 4		45	230	2	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	NIE	2	
PRAWDA	L7_3	wzorzec odniesienia jednostki ciśnienia - S03	50	7	7	4	3	5	20	T1	20	50	10	ISO 4		45	230	2	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	NIE	2	
PRAWDA	L7_4	wzorzec odniesienia jednostki siły do 1 kN	250	10	8	4	1	4	20	T0	1000000	50	5	1000000		45	380	0,5	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	
PRAWDA	L7_5	wzorzec odniesienia jednostki siły do 1 MN	150000	7	12	10	3	4	20	T0	1000000	50	5	1000000		45	380	1	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	
PRAWDA	L7_6	wzorzec odniesienia jednostki siły do 10 N	100	5	5	4	4	4	20	T0	1000000	50	5	1000000		45	380	0,5	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	
PRAWDA	L7_7	wzorzec odniesienia jednostki siły do 100 kN	15000	10	7	10	2	4	20	T0	1000000	50	5	1000000		45	380	0,5	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	
PRAWDA	L7_8	wzorzec odniesienia jednostki siły do 100 N	100				1	4	20	T0	1000000	50	5	1000000		45	380	0,5	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	
PRAWDA	L7_9	wzorzec odniesienia jednostki siły do 9 MN	9999	9	8	10	4	4	20	T0	1000000	50	5	1000000	V1	45	380	1	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	
PRAWDA	L7_10	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorców masy klas dokładności F1, F2 i M1 nr S03	10000	10	14	4	10	50	23	T0	0	50	3	1000000	V1	45	380	4	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	wentylacja z klimatyzacją	2	
FAłSZ	L7_11	Badawcze stanowisko pomiarowe użytkowych wiskozymetrów kapilarnych szklanych S02	200	6	5	4	2	0	20	T1	1000000	50	5	ISO 4		45	230	4	n	EM0	40	TAK	FAłSZ	wentylacja z klimatyzacją i dygestorium	0,5	
FAłSZ	L7_12	wzorzec odniesienia jednostki momentu siły - S08 (do 5 kNm)	300				1	4	20	T0	1000000	50	5	1000000	V1	45	380	0,5	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	
PRAWDA	L7_13	wzorzec ciśnienia dynamicznego	500	7	7	4	4	5	20	T1	20	50	10	ISO 4	V1	45	380	5	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	NIE	2	
PRAWDA	L7_14	Wzorzec odniesienia - badawcze stanowisko pomiarowe mętnościomierzy	200	7	7	5	7	10	20	T1	1000000	50	5	ISO 6		45	230	2	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	wentylacja z klimatyzacją i dygestorium	1	
PRAWDA	L7_15	Wzorzec odniesienia - badawcze stanowisko pomiarowe wzorców do analizatorów wydechu	617	7	7	4	9	20	20	T1	21	50	5	ISO 6	V1	45	230	4	n	EM0	40	TAK	PRAWDA	wentylacja z klimatyzacją	1	
PRAWDA	L7_16	wzorzec odniesienia jednostki siły do 10 kN	2000	0	0	0	2	4	20	T0	1000000	50	5	1000000	V1	45	380	0,5	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	
PRAWDA	L7_17	wzorzec odniesienia jednostki siły do 3 MN	5000				3	4	20	T0	1000000	50	5	1000000	V1	45	380	1	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	
PRAWDA	L7_18	Stanowisko badawcze pomiarów metodą pływaka magnetycznego	1000	10	10	5	2	10	20	T1	0	50	3	ISO 4	V1	40	230	4	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	wentylacja z klimatyzacją	1	kamienne konsole niezwiązane z budynkiem
PRAWDA	L7_19	Stanowisko badawcze do pomiarów metodą flotacji ciśnieniowej	1000				2	10	20	T1	0	50	3	ISO 4	V1	40	230	4	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	wentylacja z klimatyzacją	1	kamienne konsole niezwiązane z budynkiem
PRAWDA	L7_20	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania gęstościomierzy zbożowych nr S04	500	10	6	4	12	25	23	T0	0	50	3	1000000	V1	45	380	2	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	wentylacja z klimatyzacją	0,5	
PRAWDA	L7_21	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania gęstościomierzy zbożowych nr S04	500				13	25	23	T0	0	50	3	1000000	V1	45	380	2	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	wentylacja z klimatyzacją	0,5	
PRAWDA	L7_22	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wag nr S05	500	6	10	4	14	25	23	T0	0	50	3	1000000	V1	45	380	2	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	wentylacja z klimatyzacją	1	
FAłSZ	L7_23	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wag nr S05	500				15	25	23	T0	0	50	3	1000000	V1	45	380	2	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	wentylacja z klimatyzacją	1	
PRAWDA	L7_24	Stanowisko pomiarowe do badania wzorców masy i stanowisk pomiarowych do wzorcowania wzorców masy nr S06	100	6	6	4	16	25	23	T0	0	50	3	1000000	V1	45	380	2	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	wentylacja z klimatyzacją	1	
PRAWDA	L7_25	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorców masy klas dokładności E1 i E2 nr S02	500				5	25	23	T0	0	50	3	1000000	V1	45	380	2	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	wentylacja z klimatyzacją	3	
PRAWDA	L7_26	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorców masy klas dokładności E1 i E2 nr S02	500				6	25	23	T0	0	50	3	1000000	V1	45	380	2	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	wentylacja z klimatyzacją	3	
PRAWDA	L7_27	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorców kopii 1 kg nr S01	500	5	5	4	17	25	23	T1	0	50	3	1000000	V2	45	380	4	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	wentylacja z klimatyzacją	2	
PRAWDA	L7_28	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorców kopii 1 kg nr S01 – Waga Watta	500	5	5	4		25	23	T1	0	50	3	1000000	V1	45	380	4	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	wentylacja z klimatyzacją	2	
PRAWDA	L7_29	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorców masy klas dokładności F1, F2 i M1 nr S03	10000	10	10	4	11	50	23	T0	0	50	3	1000000	V1	45	380	4	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	wentylacja z klimatyzacją	2	
PRAWDA	L7_30	Badawcze stanowisko pomiarowe gęstościomierzy oscylacyjnych S02	1000	10	6	4	5	10	20	T0	1000000	50	5	ISO 6		45	230	2	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	wentylacja z klimatyzacją i dygestorium	1,1	
PRAWDA	L7_31	Wzorzec odniesienia - badawcze stanowisko pomiarowe wzorcowych wiskozymetrów kapilarnych szklanych oraz wzorców lepkości cieczy S01, magazyn wzorców	200	6	5	4	1	60	20	T1	1000000	50	5	ISO 4	V0	45	230	8	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	wentylacja z klimatyzacją i dygestorium	2	
FAłSZ	L7_32	Badawcze stanowisko pomiarowe gęstościomierzy przepływowych S06	1000	0	0	0	7	0	20	T0	1000000	50	5	1000000		45	230	4	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	wentylacja z klimatyzacją i dygestorium	0,3	
PRAWDA	L7_33	Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorców twardości Rockwella - S2	600	4	5	4		10	23	T0	1000000	1000000	1000000	1000000		45	380	2	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	wentylacja z klimatyzacją	1	
PRAWDA	L7_34	wzorzec odniesienia jednostki ciśnienia - S01	1000	9	9	4	1	70	20	T1	20	50	10	ISO 4	V1	45	380	2	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	NIE	3	Wymagania stawiane przyszłej lokalizacji
PRAWDA	L7_35	wzorzec odniesienia jednostki ciśnienia - S02	100	7	7	4	2	5	20	T1	20	50	10	ISO 4	V2	45	230	2	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	NIE	2	
FAłSZ	L7_36	Wzorzec państwowy - badawcze stanowisko pomiarowe analizatorów wydechu S01	1200	7	7	4	8	20	20	T1	21	50	5	ISO 6	V1	45	230	4	n	EM0	40	TAK	PRAWDA	wentylacja z klimatyzacją	2	
FAłSZ	L7_37	Badawcze stanowisko pomiarowe kubków wypływowych S05	100	4	5	4	2	0	20	T1	1000000	50	5	1000000		45	230	2	n	EM0	40	TAK	FAłSZ	wentylacja z klimatyzacją i dygestorium	0,5	
FAłSZ	L7_38	Badawcze stanowisko pomiarowe wiskozymetrów Höplera S04	100	4	5	4	4	0	20	T1	1000000	50	5	1000000		45	230	4	n	EM0	40	TAK	FAłSZ	wentylacja z klimatyzacją i dygestorium	0,5	
FAłSZ	L7_39	Badawcze stanowisko pomiarowe wzorców lepkości cieczy w temperaturach (25÷ 80) °C S03	250				3	0	20	T1	1000000	50	5	ISO 4	V0	45	230	4	n	EM0	40	TAK	FAłSZ	wentylacja z klimatyzacją i dygestorium	0,5	
PRAWDA	L7_40	Państwowy wzorzec gęstości - badawcze stanowisko pomiarowe ważenia hydrostatycznego S01	6000	8	8	5	1	10	20	T2	0	50	3	ISO 4	V1	40	230	6	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	wentylacja z klimatyzacją	2	kamienne konsole niezwiązane z budynkiem
FAłSZ	L7_41	Stanowisko badawcze pomiarów napięcia powierzchniowego S04	500	5	5	4	6	0	20	T1	1000000	50	5	ISO 6	V1	45	230	2	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	wentylacja z klimatyzacją i dygestorium	0,2	
FAłSZ	L7_42	Stanowisko badawcze pomiarów piknometrycznych S03	500				5	0	20	T1	1000000	50	5	ISO 6	V1	45	230	2	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	wentylacja z klimatyzacją i dygestorium	0,4	

FAłSZ	L7_43	wzorzec odniesienia jednostki momentu siły do sił dynamicznych do 1 kNm	150	6	5	4	2	4	20	T0	1000000	50	5	1000000	V1	45	380	0,5	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	
FAłSZ	L7_44	wzorzec odniesienia jednostki momentu siły do sił dynamicznych do 10 kNm	300	8	5	5	3	4	20	T0	1000000	50	5	1000000	V1	45	380	0,5	w	EM0	40	TAK	FAłSZ	NIE	0,5	
PRAWDA	L8_1	Stanowiska wzorca pierwotnego dawki pochłoniętej w wodzie w polu promieniowania wysokoenergetycznych elektronów oraz wysokoenergetycznego promieniowania X + sterownia	10000	10	10	3,5	2	20	20	T2	1000000	50	1	C	V0	1000000	400	15	w	EM0		TAK	FAłSZ	NIE	2	z wymaganiami PAA i specyfikacją akceleratora
PRAWDA	L8_2	Stanowisko do pomiarów promieniowania beta + sterownia	300	10	10	3,5	5	0	20	T0	1000000	50	1	C		1000000	230	1	w	EM0		TAK	FAłSZ	NIE	2	z wymaganiami PAA
PRAWDA	L8_3	Stanowisko wzorca pierwotnego dawki pochłoniętej w wodzie w polu promieniowania gamma nuklidu Co60 + sterownia	5000	10	10	3,5	3	10	20	T2	1000000	50	1	C	V0	1000000	230	1	w	EM0		TAK	FAłSZ	NIE	2	z wymaganiami PAA i specyfikacją głowicy terapeutycznej
PRAWDA	L8_4	Stanowisko wzorca pierwotnego kermy w powietrzu i dawki pochłoniętej w wodzie w polu promieniowania gamma i X stosowanego w brachyterapii + sterownia	500	0	0	0	3	0	20	T2	1000000	50	1	C	V0	1000000	230	1	w	EM0		NIE	FAłSZ	NIE	2	z wymaganiami PAA
PRAWDA	L8_5	Stanowiska wzorca pierwotnego dawki pochłoniętej w wodzie w polu promieniowania X o średniej energii fotonów + sterownia	500	10	10	3,5	1	10	20	T2	1000000	50	1	C	V0	1000000	380	15	w	EM0		TAK	FAłSZ	NIE	2	z wymaganiami PAA
PRAWDA	L8_6	Stanowisko do wzorcowania przyrządów wykorzytywanych w radiografii medycznej + sterownia	500	0	0	0	1	0	20	T2	1000000	50	1	C	V0	1000000	380	15	w	EM0		TAK	FAłSZ	NIE	2	z wymaganiami PAA
FAłSZ	L8_7	Stanowisko do pomiarów pól neutronowych + sterownia	1000	15	15	15	8	0	20	T2	1000000	50	1	C		1000000	230	1	w	EM0		NIE	FAłSZ	NIE	2	z wymaganiami PAA
FAłSZ	L8_8	Stanowisko wzorca aktywności + pracownia spektrometrii	1000	10	10	3,5	6	10	20	T0	1000000	50	1	C		1000000	230	1	w	EM0		TAK	FAłSZ	dygestorium	2	z wymaganiami PAA
FAłSZ	L9_1	Stanowisko do badania przyrządów pomiarowych stosowanych do pomiaru cieczy w kanałach otwartych		40	10	12	6	0	20		1000000	1000000		1000000		1000000	380	1	w	EM0		TAK	PRAWDA	wentylacyjna	0,5	Stanowisko wewnątrz stanowiska L9_2 (Wielkie przepływy wody)
FAłSZ	L9_2	Stanowisko wzorcowe wielkich przepływów (hala pomiarowa ze zbiornikiem magazynowym i wieża grawitacyjna)	300000	70	20	12	6	0	20		1000000	50	25	1000000		1000000	600	2000	w	EM0	10	TAK	PRAWDA	kanalizacja - ścieki technologiczne, wentylacyjno - klimatyzacyjna	1	w kolumnach 9 -15 i 26 podano dane szacunkowe. Dokładne dane po wykonaniu projektu technicznego, zbiornik magazynowy na poziomie -1
FAłSZ	L9_3	Stanowisko badawcze średnich i wielkich przepływów gazu przy wysokim ciśnieniu (zastąpienie i rozbudowa S05)		30	8	6	1	150	20		1000000			1000000		1000000	380	300	w	EM0		TAK	FAłSZ	NIE	0,5	Prawd. osobny budynek. Rozszerzenie zakresu dotychczasowego stanowiska S05. Dodatkowe pomieszczenia na wentylatory izolowane pod względem akustyki, drgań i temperatury. Możliwe osobne zbiorniki na gaz poza budynkiem. W kolumnach 9 -15 i 26 podano dane sza
FAłSZ	L9_4	Stanowisko do badania liczników do cieczy innych niż woda		18	11	5	8	0	20		1000000	1000000		1000000		1000000	380	200	w	EM0		TAK	PRAWDA	wentylacyjna	0,5	Możliwa lokalizacja poza kampusem laboratoryjnym
FAłSZ	L9_5	Stanowisko wzorcowe do badania instalacji i liczników do cieczy kriogenicznych (w tym LNG)		10	10	4	10	0			1000000	1000000		1000000		1000000	380	25	w	EM0		NIE	FAłSZ	wentylacyjna	0,75	Prawd. osobny budynek. W kolumnach 9 -15 i 26 podano dane szacunkowe. Dokładne dane po wykonaniu projektu technicznego. Budowa stanowiska we współpracy z CLPB PGNiG. Możliwa lokalizacja poza kampusem laboratoryjnym.
FAłSZ	L9_6	Stanowisko do badania odmierzaczy gazu ciekłego propan butan LPG		12	8	4	9	0			1000000	1000000		1000000		1000000	380	25	w	EM0		NIE	FAłSZ	wentylacyjna	0,75	Osobny budynek. W kolumnach 9 -15 i 26 podano dane szacunkowe. Dokładne dane po wykonaniu projektu technicznego. Możliwa lokalizacja poza kampusem laboratoryjnym
FAłSZ	L9_7	Stanowisko badawcze liczników CNG		0	0	0	4	30	20		1000000			1000000		1000000	380	30	w	EM0	1000000	TAK	FAłSZ	wentylacyjna	0,5	Prawd. osobny budynek. Wymagane dodatkowe zbiorniki magazynowe poza budynkiem. W kolumnach 9 -15 i 26 podano dane szacunkowe. Dokładne dane po wykonaniu projektu technicznego
FAłSZ	L9_8	Stanowisko do badań zmęczeniowych wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody	5000	7	4	4	6	25	20		1000000	50	25	1000000		1000000	230	35	w	EM0	3	TAK	FAłSZ	kanalizacja	1	
FAłSZ	L9_9	Stanowisko do małych przepływów (woda)	1200	5	2	3	7	50	20	T0	1000000	50	25	1000000	V0	1000000	230	1	w	EM0	3	TAK	FAłSZ	NIE	1	budowa w GUM przed 22
FAłSZ	L9_10	Stanowisko do mikroprzepływów (woda)	1200	5	2	3	7	50	20	T0	1000000	50	25	1000000	V0	1000000	230	1	w	EM0	3	TAK	FAłSZ	NIE	1	budowa w GUM przed 22
FAłSZ	L9_11	Stanowisko pomiarowe / badawcze do wzorcowania / badania przyrządów do pomiaru objętości metodą wagową	400	12	10	3	12	20	20	T0		50	10		V0	1000000	230	5	w	EM0		TAK	FAłSZ	klimatyzacja, Dygestorium z instalacją wyciągową, gazową, wodno-kanalizacyjną i elektryczną	1	klimatyzacja (reg. temp. i wilgotności, przepływ laminarny-bezwiatrowy), wykładzina podłogowa antystatyczna
FAłSZ	L9_12	Stanowisko pomiarowe do badania przeliczników do gazomierzy	30	4	3	3	3	0	20	T0	1000000	60	15	1000000		1000000	230	2	n	EM0		NIE	FAłSZ	klimatyzacja z wymianą powietrza	0,5	
FAłSZ	L9_13	Stanowisko pomiarowe do kalibracji dysz Venturiego	30	3	2	6	5	0	20	T0	1000000	60	15	1000000	V0	1000000	380	5	n	EM0		TAK	PRAWDA	klimatyzacja z wymianą powietrza	0,5	budowa poza GUM - dodatkowo - śluza powietrzna (stabilizacja wahań ciśnienia)
FAłSZ	L9_14	Stanowisko pomiarowe z wzorcem tłokowym (przepływy do 16 m3/h, cisnienie do 6 bar)	1000	4	7	6	2	0	20	T0	1000000	60	15	1000000	V0	1000000	380	10	n	EM0		TAK	PRAWDA	klimatyzacja z wymianą powietrza	0,75	budowa w GUM przed 22, budowa poza GUM - dodatkowo - śluza powietrzna (stabilizacja wahań ciśnienia)
FAłSZ	L9_15	Stanowisko pomiarowe z wzorcem tłokowym (mikroprzepływy, ciśnienie do 6 bar, zastąpienie i rozbudowa S07)	400	4	3	3	3	0	20	T0	1000000	60	15	1000000	V0	1000000	380	5	n	EM0		TAK	PRAWDA	klimatyzacja z wymianą powietrza	0,75	budowa w GUM przed 22, budowa poza GUM - dodatkowo - śluza powietrzna (stabilizacja wahań ciśnienia)
FAłSZ	L9_16	Stanowisko pomiarowe z wzorcowym zbiornikiem dzwonowym 2,5 m3 (zastąpienie S03, częściowe odtworzenie stanowiska S04)	2000	5	7	6	2	0	20	T0	1000000	60	15	1000000	V0	1000000	380	15	n	EM0		TAK	PRAWDA	klimatyzacja z wymianą powietrza	0,5	budowa w GUM przed 22, budowa poza GUM - dodatkowo - śluza powietrzna (stabilizacja wahań ciśnienia)
FAłSZ	L9_17	Stanowisko z wzorcami tłokowymi	100	3	3	3	3	0	20	T0	1000000	60	15	1000000	V0	1000000	230	5	n	EM0		NIE	FAłSZ	klimatyzacja z wymianą powietrza	0,5	
FAłSZ	L9_18	Stanowisko do badania i wzorcowania wodomierzy i przepływomierzy do wody zimnej i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody	20000	15	5	6	6	90	20		1000000	50	25	1000000		1000000	230	30	w	EM0	3	TAK	FAłSZ	kanalizacja	1	
FAłSZ	L9_19	Stanowisko do badania i wzorcowania wodomierzy, przepływomierzy do wody i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody	5000	5	3	6	6	40	20		1000000	50	25	1000000		1000000	230	15	w	EM0	3	TAK	PRAWDA	kanalizacja	1	
FAłSZ	L9_20	Stanowisko do badania wytrzymałości ciśnieniowej wodomierzy	200	2	2	3	6	30	20		1000000	50	25	1000000		1000000	230	0,5	w	EM0	3	TAK	FAłSZ	kanalizacja	1	
FAłSZ	L9_21	Stanowisko pomiarowe do badania ciepłomierzy zespolonych (rozbudowa stanowiska S03 woda, część przepływowa stanowiska)	2500	8	6	5	6	0	23		1000000	50	25	1000000		1000000	230	20	w	EM0		TAK	PRAWDA	NIE	1	budowa w GUM przed 22; obwody dwufazowe: 16X16A, 2X25A, obwody trójfazowe: 2X25A, 8X16A
FAłSZ	L9_22	Stanowisko pomiarowe do badania ciepłomierzy hybrydowych stosowanych w układach chłodzenie - w zakresie przeliczników z parami czujników temperatury	450	2	2	3	11	2	23		1000000	50	25	1000000		1000000	230	20	w	EM0		TAK	PRAWDA	NIE	1	budowa w GUM przed 22; obwody dwufazowe: 16X16A, 2X25A, obwody trójfazowe: 2X25A, 8X16A
FAłSZ	L9_23	Stanowisko pomiarowe do badania typu UE ciepłomierzy hybrydowych w zakresie przeliczników z parami czujników temperatury	300	2	2	3	11	2	23		1000000	50	25	1000000		1000000	230	20	w	EM0		TAK	PRAWDA	NIE	1	obwody dwufazowe: 16X16A, 2X25A, obwody trójfazowe: 2X25A, 8X16A
FAłSZ	L9_24	Stanowisko pomiarowe do badania typu UE par czujników temperatury – podzespołów ciepłomierzy	300	2	2	3	11	2	23		1000000	50	25	1000000		1000000	230	20	w	EM0		TAK	PRAWDA	NIE	0,75	obwody dwufazowe: 16X16A, 2X25A, obwody trójfazowe: 2X25A, 8X16A
FAłSZ	L9_25	Stanowisko pomiarowe do badania typu UE przeliczników – podzespołów ciepłomierzy	100	4	4	3	11	0	23		1000000	50	25	1000000		1000000	230	30	w	EM0		TAK	PRAWDA	NIE	0,75	obwody dwufazowe, 8X16A
FAłSZ	L9_26	stanowisko z wzorcowym zbiornikiem dzwonowym 0,2 m3	500	4	3	6	5	0	20	T0	1000000	60	15	1000000	V0	1000000	380	15	n	EM0		TAK	PRAWDA	klimatyzacja z wymianą powietrza	0,5	budowa poza GUM - dodatkowo - śluza powietrzna (stabilizacja wahań ciśnienia)
PRAWDA	L10_1	Pracownia parametrów klimatu		7	6	3		0	23	T0	1000000	40	10	1000000		1000000	380	25	w	EM0	40	TAK	PRAWDA		2	Dygestorium
PRAWDA	L10_2	Pracownia termometrii radiacyjnej		7	6	3		0	23	T0	1000000	40	10	1000000		1000000	380	25	w	EM0	40	TAK	FAłSZ		2	
FAłSZ	L10_3	Pracownia państwowego wzorca temperatury		7	6	3		0	23	T1	1000000	40	10	1000000		1000000	380	25	w	EM0	40	TAK	FAłSZ		2	
FAłSZ	L10_4	Pracownia temperatury dla punktów stałych		12	7	3		30	22		1000000	40	10	1000000		1000000	380	25	w		40	TAK	FAłSZ		1,5	Dygestorium
FAłSZ	L10_5	Pracownia termoelementów - punkty stałe		7	7	3		0	23		1000000	40	10	1000000		1000000	380	15	w		40	TAK	FAłSZ		1,5	
FAłSZ	L10_6	Pracownia termoelementów - metoda porównawcza		7	4	3		0	23		1000000	40	10	1000000		1000000	380	10	w		40	TAK	FAłSZ		1,5	
FAłSZ	L10_7	Pracownia temperatury dla pomiarów metodą porównawczą		7	5	3		0	22		1000000	40	10	1000000		1000000	380	15	w		40	TAK	FAłSZ		1,5	Dygestorium
FAłSZ	L10_8	Pracownia wzorca odniesienia temperatury punktu rosy/szronu		6	5	3		0	23		1000000	40	10	1000000		1000000	380	25	w		1000000	TAK	PRAWDA		1	
FAłSZ	L10_9	Pracownia generatora dwustrumieniowego temperatury punktu rosy/szronu		5	4	3		0	23		1000000	40	10	1000000		1000000	380	25	w		1000000	TAK	PRAWDA		1	
FAłSZ	L10_10	Pracownia wzorca odniesienia wilgotności względnej		7	5	3		0	23		1000000	40	10	1000000		1000000	380	25	w		1000000	TAK	PRAWDA		1	
FAłSZ	L10_11	Pracownia wilgotności zbóż, nasion oleistych i ciał stałych		5	4	3		0	23		1000000	40	10	1000000		1000000	380	25	w		1000000	TAK	PRAWDA		1	
FAłSZ	L11_1	Stanowisko badan bezpieczenstwa cyfrowego część 1/4	100	10	10		10	0	23	T0	1000000	60	10	1000000		1000000	380	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ	WiFi, wewn. odrębny LAN, ochrona ESD stanowisk pracy, wentylacja i wyciagi powietrza nad lab.elektronicznym	5	Nowe laboratorium technologii bezp. cyfrowego dla potrzeb metrologii

FAłSZ	L11_2	Stanowisko badan bezpieczenstwa cyfrowego część 2/4	100	5	5		11	0	23	T0	1000000	60	10	1000000		1000000	380	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ	WiFi, wewn. odrębny LAN, ochrona ESD stanowisk pracy, wentylacja i wyciagi powietrza nad lab.elektronicznym		Nowe laboratorium technologii bezp. cyfrowego dla potrzeb metrologii
FAłSZ	L11_3	Stanowisko badan bezpieczenstwa cyfrowego część 4/4	100	5	5		13	0	23	T0	1000000	60	10	1000000		1000000	380	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ	WiFi, wewn. odrębny LAN, ochrona ESD stanowisk pracy, wentylacja i wyciagi powietrza nad lab.elektronicznym		Nowe laboratorium technologii bezp. cyfrowego dla potrzeb metrologii
FAłSZ	L11_4	Stanowisko badan bezpieczenstwa cyfrowego część 3/4	100	5	5		12	0	23	T0	1000000	60	10	1000000		1000000	380	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ	WiFi, wewn. odrębny LAN, ochrona ESD stanowisk pracy, wentylacja i wyciagi powietrza nad lab.elektronicznym		Nowe laboratorium technologii bezp. cyfrowego dla potrzeb metrologii
PRAWDA	L11_5	Stanowisko zasobów i obsługi IT	100	5	5		14	0	23	T0	1000000	1000000	1000000	1000000		1000000	380	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ		6	Potrzeby szczegolowe zostana dostosowane do nieprzewidywalnych jeszcze potrzeb lab.metrologicznych, we wspolpracy z dzialem IT - DOSTOSOWANIE ZARZADZANIA ZASOBAMI SPECJALISTYCZNYMI IT DOSTOSOWANE DO POTRZEB LAB
PRAWDA	L11_6	Stanowisko zasobów i obsługi IT	100	5	5		14	0	23	T0	1000000	1000000	1000000	1000000		1000000	380	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ		6	Potrzeby szczegolowe zostana dostosowane do nieprzewidywalnych jeszcze potrzeb lab.metrologicznych, we wspolpracy z dzialem IT - DOSTOSOWANIE ZARZADZANIA ZASOBAMI SPECJALISTYCZNYMI IT DOSTOSOWANE DO POTRZEB LAB
PRAWDA	L11_7	Stanowisko rozwoju oprogramowania i metod numerycznych część 1/3	100	7	7		1		23	T0	1000000	60	10	1000000		1000000	230	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ	WiFi, wewn. odrębny LAN, zasoby sieciowe - moc obliczeniowa	7	Obecny dzis w GUM załążek stanowiska. Lokalizacja w Kielcach zalezna od lokalnych potrzeb laboratoriów metrologicznych
PRAWDA	L11_8	Stanowisko rozwoju oprogramowania i metod numerycznych część 2/3	100	5	5		2		23	T0	1000000	60	10	1000000		1000000	230	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ	WiFi, wewn. odrębny LAN, zasoby sieciowe - moc obliczeniowa		Obecny dzis w GUM załążek stanowiska. Lokalizacja w Kielcach zalezna od lokalnych potrzeb laboratoriów metrologicznych
PRAWDA	L11_9	Stanowisko rozwoju oprogramowania i metod numerycznych część 3/3	100	5	5		3		23	T0	1000000	60	10	1000000		1000000	230	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ	WiFi, wewn. odrębny LAN, zasoby sieciowe - moc obliczeniowa		Obecny dzis w GUM załążek stanowiska. Lokalizacja w Kielcach zalezna od lokalnych potrzeb laboratoriów metrologicznych
FAłSZ	L11_10	Stanowisko testowania oprogramowania część 1/3	100	7	7		4	50	23	T0	1000000	60	10	1000000		1000000	230	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ	WiFi, wewn. odrębny LAN, ochrona ESD stanowisk pracy	10	Rozwoj obecnie istniejacego zespolu w celu dostosowania do nowych potrzeb.
FAłSZ	L11_11	Stanowisko testowania oprogramowania część 2/3	100	7	7		5	50	23	T0	1000000	60	10	1000000		1000000	230	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ	WiFi, wewn. odrębny LAN, ochrona ESD stanowisk pracy		Rozwoj obecnie istniejacego zespolu w celu dostosowania do nowych potrzeb.
FAłSZ	L11_12	Stanowisko testowania oprogramowania część 3/3	100	7	7		6	50	23	T0	1000000	60	10	1000000		1000000	230	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ	WiFi, wewn. odrębny LAN, ochrona ESD stanowisk pracy		Rozwoj obecnie istniejacego zespolu w celu dostosowania do nowych potrzeb.
PRAWDA	L11_13	Stanowisko oprogramowania i technologii IT część 1/3	100	5	6		7	30	23	T0	1000000	60	10	1000000		1000000	230	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ	WiFi, wewn. odrębny LAN, ochrona ESD stanowisk pracy	6	Rozwoj obecnie istniejacego zespolu w celu dostosowania do nowych potrzeb.
PRAWDA	L11_14	Stanowisko oprogramowania i technologii IT część 2/3	100	5	5		8	25	23	T0	1000000	60	10	1000000		1000000	230	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ	WiFi, wewn. odrębny LAN, ochrona ESD stanowisk pracy		Rozwoj obecnie istniejacego zespolu w celu dostosowania do nowych potrzeb.
PRAWDA	L11_15	Stanowisko oprogramowania i technologii IT część 3/3	100	5	5		9	25	23	T0	1000000	60	10	1000000		1000000	230	1	w	EM0	1000000	NIE	FAłSZ	WiFi, wewn. odrębny LAN, ochrona ESD stanowisk pracy		Rozwoj obecnie istniejacego zespolu w celu dostosowania do nowych potrzeb.
FAłSZ	L11_16	stanowisko badawcze budowy i rozwoju kwantowych metod pomiarowych	3000	20	20	4	15	100	20	T0	15	40	5	Klasa C (max. dopuszczalna liczba cząstek/m3 zgodnie z PN-EN ISO 1464t4-1)		45	380	50	w	EM0	40	TAK	PRAWDA	ciekły azot	3	